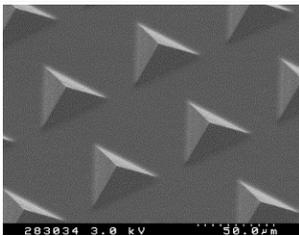


(様式 1)

| | |
|----------------|--|
| 1. 研究者 | 平井義和、田畑修 |
| 2. 研究者 DB 等 | http://researchmap.jp/7000008799/ (平井) http://rns.nii.ac.jp/d/nr/1000020288624 (田畑) |
| 3. 所属 | 京都大学 大学院/工学研究科/マイクロエンジニアリング専攻 |
| 4. 研究テーマ | ナノテクノロジーハブ拠点を活用した厚膜有機材料の 3 次元微細加工技術 |
| 5. 利用可能な施設・装置等 |   <p>ナノハブ・クリーンルーム 試作した 3 次元構造体</p> <p>【主なプロセス装置】レーザー直接描画装置、高速マスクレス露光装置、移動マスク紫外線露光装置、露光装置 (ステッパ)、両面マスクアライナー、厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置 他</p>   <p>高速マスクレス露光装置 レーザー直接描画装置</p> <p>【主な分析装置】3 D測定レーザー顕微鏡、触針式段差計、分析走査電子顕微鏡 他</p>   <p>触針式段差計 3 D測定レーザー顕微鏡</p> |
| 6. 研究室等 HP | http://www.nms.me.kyoto-u.ac.jp/ |
| 7. E-MAIL | hirai@me.kyoto-u.ac.jp |
| 8. TEL | 075-383-3693 |
| 9. 特記事項 | 京大ナノハブ拠点に設置されている高速マスクレス露光装置や移動マスク紫外線露光装置をはじめとする紫外線リソグラフィ装置を活用し、ナノ・マイクロデバイスの高機能化を実現する厚膜有機材料の 3 次元加工とその応用研究、さらに計算機シミュレーションを利用したプロセスの高精度化を目指した研究を推進。 |